

# Cesto De Limpeza Para Fotomasco Personalizado Em Ptfе Resistente À Corrosão De 6 Polegadas Com Duas Alças

Número do item: PL-CP05



## introdução

Os cestos de limpeza personalizados em PTFE de 6 polegadas com duas alças e alto desempenho oferecem resistência química inigualável para processos úmidos de semicondutores e laboratórios. Esses cestos duráveis garantem manuseio seguro de amostras, drenagem rápida e limpeza sem contaminação em ácidos e solventes agressivos.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
<b>Limpeza RCA de Semicondutores</b>	Imersão sequencial de wafers de silício em soluções SC-1 e SC-2 para remover contaminantes orgânicos e metálicos.	Resistência total a agentes oxidantes e ácidos de alta temperatura garante nenhuma degradação do transportador.
<b>Gravação de Fotomascos</b>	Segurar fotomascos de 6 polegadas durante a remoção de camadas de cromo ou outras camadas bloqueadoras de luz usando gravantes agressivos.	Posicionamento seguro evita vibração da máscara, garantindo transferência de padrão de alta fidelidade e zero risco de arranhões na superfície.
<b>Texturização de Células Solares</b>	Processo de criação de micro-pirâmides em superfícies de silício usando misturas de KOH ou HF/HNO3 para melhorar a absorção de luz.	Design durável de duas alças permite manuseio seguro em ambientes industriais de alto volume e tanques profundos.
<b>MEMS &amp; Microfluídica</b>	Limpeza e gravação de substratos de vidro ou silício usados na fabricação de Sistemas Micro-Eleto-Mecânicos.	A pureza do material evita a introdução de impurezas traço que poderiam interferir na função do dispositivo em microescala.
<b>Utensílios de Laboratório para Análise de Traços</b>	Segurar béqueres, tampas ou pequenos componentes durante limpeza especializada com vapor de ácido ou imersão.	Ausência garantida de íons metálicos (livre de íons) o torna o padrão ouro para suporte em análise de elementos ultra-traço.
<b>Preparação de Vidro Condutivo</b>	Limpeza de substratos de vidro revestidos com ITO ou FTO para pesquisa de células solares OLED ou de perovskita.	O design em grade permite contato completo do fluido com a camada condutiva enquanto protege as bordas do substrato.
<b>Revelação Química Úmida</b>	Transportar wafers revestidos com fotoresist expostos através de soluções reveladoras em fluxos de trabalho de litografia.	Estabilidade química em vários reveladores orgânicos garante resultados consistentes e zero interação com o material.

Parâmetro	Detalhes da Especificação (Modelo: PL-CP05)
<b>Material Primário</b>	Polytetrafluoroetileno (PTFE) Virgem de Alta Pureza 100%
<b>Compatibilidade com Substrato</b>	Fotomascos, Wafers ou Vidro Padrão de 6 polegadas (152,4 mm)
<b>Configuração das Alças</b>	Suporte Reforçado de Duas Alças para levantamento vertical balanceado
<b>Resistência à Temperatura</b>	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
<b>Compatibilidade Química</b>	Universal (Todos os ácidos, bases, solventes orgânicos e soluções piranha)
<b>Configuração das Ranhuras</b>	Largura, espaçamento e capacidade total personalizáveis (padrão 10/25 ranhuras)
<b>Características Estruturais</b>	Base em grade usinada em CNC para drenagem rápida; pontos de contato com a amostra arredondados

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Parâmetro	Detalhes da Especificação (Modelo: PL-CP05)	
<b>Acabamento Superficial</b>	Superfície de PTFE usinada lisa e não porosa (Baixo atrito)	
<b>Altura das Alças</b>	Personalizável para atender a profundidades específicas do tanque de limpeza	
<b>Conteúdo Metálico</b>	Zero (Construção livre de metais)	